## ナノ粒子からなる フォトニックバンドギャップ構造の形成

西山宏昭\*

Photonic band-gap structures consisting of nanoparticles in glass films Key Words : Photonic band-gap, laser, periodic structure, nanoparticle, glass films

1.はじめに

研究ノート

近年,金属や半導体の分散ナノ粒子を用いたガラ ス材料の高機能化が注目されている.これはナノ粒 子がそのサイズ効果により,バルクでは実現困難な 特性を発現するためである.例えば, Er-SiO2中に Si や Ge のナノ粒子を分散させておくと, Er イオン を介した発光強度が著しく増大することが報告され ている1). これまで報告されている様々なナノ粒 子の析出方法は,加熱などにより試料全体から析出 させるものが多く,その析出位置を制御することは 困難であるが、今後、分散ナノ粒子を集積機能素子 作製へ応用していくためには,任意の位置で高い空 間分解能を持ってナノ粒子を析出させる手法が必要 となる.特にガラスが母材として多用されている光 デバイスへの応用を考えた場合,光信号として用い られる波長 1.5 µ m の半分以下の空間分解能で析出 させることができれば,最近,盛んに研究されてい るフォトニックバンドギャップを利用した光波制御 技術の活用も期待できる.一方,紫外から可視波長 のレーザ光照射によってガラスに局所的な構造変化 を誘起できることが知られている.このレーザ誘起 構造変化は低強度照射によるガラスの表面改質的な 変化であり , 構造変化とともに屈折率の変化をも生 み出すため,ガラスをベースとした光デバイスに新



\*Hiroaki NISHIYAMA

1976年3月生 大阪大学大学院工学研究科生産科学専攻 (2004年) 現在.大阪大学大学院 工学研究科 マ テリアル生産科学専攻 助教 (博士)工 学 透明材料への光学機能付与 TEL:06-6879-7535 FAX:06-6879-7570 E-mail:hiroaki@mapse.eng.osaka-u.ac.jp たな光学的機能を付与することができる<sup>2)</sup>.この プロセスは簡便ではあるが,照射によって起こる構 造変化は,イオン間の結合距離や結合角を僅かに変 化させる程度に過ぎず,また,一般に安定性が低く, 100 程度の加熱に対しても著しく減衰することが 指摘されてきた<sup>3)</sup>.

ここでは,光ファイバーや導波路母材に用いられ ている GeO2-B2O3-SiO2 系ガラスにおいて,レーザ 光照射の他にガラスの相変化を新たな因子として利 用することで誘起されるレーザ光照射部での大規模 な構造の変化と,半導体 Ge ナノ粒子からなるフォ トニックバンドギャップ構造の形成について述べる<sup>4)</sup>.

## 2.ナノ粒子からなる周期構造の形成

図1は,SiO2薄膜で上部クラッディングされた GeO2-B2O3-SiO2薄膜(以下,GBS)に紫外パルス レーザで書き込んだ光誘起グレーティングに,窒素 雰囲気下で600 での熱処理を施した際の屈折率変 調量 nの変化を示している.熱処理前の nは 6.9×10<sup>-4</sup>であったが,この測定の前に500 で1時 間の熱処理を施し,光誘起グレーティングを完全に 消失させた.600 での熱処理によって nは顕著



図1 600 で熱処理を施したときの熱誘起グレーティングの 屈折率変調量 nの変化. に増加し,5時間の熱処理後に得られた最大値は熱 処理前のおよそ 10 倍に相当する 6.8 × 10-3であった. この熱的に誘起されたグレーティング(以下,TG) は,500 までの再加熱を施しても全く減衰しなか った.この TG の起源を調べるため, HF溶液を用 いて, グレーティングをエッチングした. 図2(a) はエッチング後のグレーティング領域のSEM 像で ある.直径20-40 nm の微粒子が周期的に析出し ていることが分かる.600 で80分間の熱処理に よって, TG を形成した薄膜の XRD パターンを測定 したところ,2 = 27.3 °, 45.3 °, 53.7 °に信号が検出 された.これらの信号は cubic Ge 結晶の回折線に 分類できる.これらの信号と図 2(a)で観察された ナノ粒子は,600 での熱処理前には全く見られな かったことから, TG の起源は, 半導体 Ge ナノ粒 子の周期的な析出であると考えられる.次に2次元 TG を形成した.まず,薄膜に上述のように1次元 の光誘起グレーティングを形成し,その後,サンプ ルを平面方向に 90 度回転させ,再び同条件でグレ ーティングを書き込んだ.最後に600 で80分間 の熱処理を施し,2次元TGを形成した.図2(b) はエッチングを施した2次元TGの表面のSEM像 であるが,アイランド状のパターンが確認できる. この格子における交差部では,非交差部の2倍のパ ルス数が照射されているが, TG と光誘起グレーテ ィングのどちらの回折効率にも顕著な差は見られな かった.それゆえ,交差部と非交差部間で差はない と考えられ, Fig. 2(b)の析出パターンはGeナノ粒 子が主として非照射部から析出したと判断できる. 図 3(a)と3(b)は,10分間の熱処理の後,エッチ ングを施した膜において, TG を形成した領域と形 成していない領域の表面の SEM 像である.図3(a) において, Geナノ粒子の析出はほとんど見られな かったが,直径300 nm以下のディンプルが無数に 観察された.このようなディンプルは熱処理前には 全く見られなかった.過去にB-SiO2ガラスに関し, 600 以下の温度で相分離が起きることが報告され ている5). このことから,ディンプルは,熱処理 時に形成された耐酸性が低い B-rich 相が周囲より 先にエッチングされた跡だと考えられる.一方,図 3(b)では,ディンプルが照射部において優先的に 形成されていた.このことは,熱処理前の照射が, 600 での熱処理時の相分離を促進したことを強く



図 2 HF溶液によるエッチング後の(a) 1次元及び (b) 2次元熟誘起グレーティングの SEM像. 格子周期は530 nm.



図3 HF溶液によるエッチング後の(a)非照射膜と(b)熱誘起 グレーティング形成膜のSEM像.熱誘起グレーティン グ形成のための熱処理時間は10分間.

示唆している.以上の結果から,以下のTGの形成 機構が考えられる.まず,600 での熱処理によっ て誘起された相分離の初期段階において,照射部で はB-rich 相が優先的に形成される.このB-rich 相 の形成により,照射部のGeが非照射部へ排出され, 非照射部のGe濃度は照射部よりも高くなる.600 での熱処理が十分に施されると,Ge-rich な領域で ある非照射部から高屈折率なGeナノ粒子が析出し, 照射部と非照射部間で大きな屈折率差が形成された と推察される.また,薄膜はSiO2によってクラッ ディングされているため,これらの変化に外気は関 与せず,薄膜内部だけの反応の結果であると考えら れる.

## 3.光導波路への内装

図4は,TG( n=1.6 × 10<sup>-3</sup> @ 632.8 nm)を誘起 したGBS に半導体プロセスによって作製したチャ ネル構造にHF エッチングを施した後のSEM 像で ある.HF エッチング前には,表面および側壁は極 めて平滑であり,ドライエッチングによる側壁の荒 れもほとんど認められなかったが,HF 溶液でエッ チングすることによってGeナノ粒子が導波路内部 で周期的に析出していることが確認できる.HF エ ッチングを施していないチャネル構造にSiO2 ガラ スをオーバクラッディングし,シングルモード導波 路を作製し,近赤外波長域での透過スペクトルを測



図4 ドライエッチングによって作製したチャネル構造の SEM像.HFエッチング後に観察した.

定した.TG の相互作用長は5mmのとき,1.5µm 帯でおよそ40dB ものフォトニックバンドギャップ が観察され,可視波長域だけでなく,近赤外波長域 でも大きな nを示すことが確認された.また, 500 までの再加熱に対しても効率が変化すること は全くなく,高い安定性も確認された<sup>6)</sup>. 4.おわりに

ガラスのレーザ誘起構造変化と熱誘起相変化を利 用して,Geナノ粒子からなるフォトニックバンド ギャップ構造を形成した.レーザ光照射だけで得ら れる従来の光誘起グレーティングに比べて,およそ 10倍もの屈折率差を得た.今後,このガラス系を テンプレートとして用い,希土類イオンなどを添加 することで,発光特性を始めとする様々な光機能の 実現が期待できる.

## 参考文献

- 1 . C. L. Heng, *et. al.*, Appl. Phys. Lett., **85** (2004) 4475.
- **2** . K. O. Hill, *et. al.*, J. Lightwave Technol., **15** (1997) 1263.
- **3**. T. Erdogan, *et. al.*, J. Appl. Phys., **76** (1994)73.
- **4** . H. Nishiyama, *et. al.*, Appl. Phys. Lett., **85** (2004) 3734.
- **5** . R. J. Charles, *et. al.*, J. Am. Ceram. Soc., **51** (1968) 16.
- 6 . H. Nishiyama, et. al., Opt. Exp., 15 (2007) 2047.

